



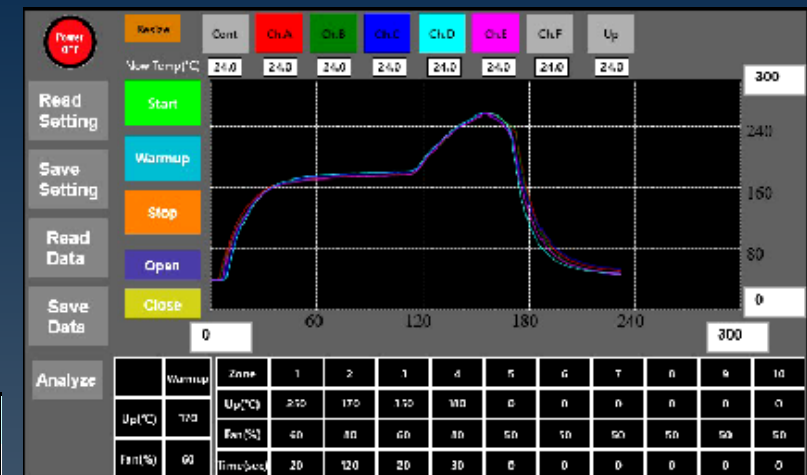
セル生産用 静止型リフロー装置・RDT-250EC

基板を固定したまま様々な温度プロファイルを実現！
開発・試作・評価からセル生産対応まで幅広く対応します！

特徴

- MAX・350 の高温加熱対応。
- 時間軸で各ヒーターを制御し、多様な温度プロファイルを自在に設定可能。
- 独自のマトリックス制御により、均一な温度分布 (Δt) 性能を実現。
- 窒素 (N₂) 雰囲気での加熱・冷却 (オートクーリング仕様) が可能。
- 7ch (自動モード時) の温度測定機能により、プロファイル解析を簡易化。
- カメラ観察システム (VDM-3) を併用する事で、加熱状態の観察が可能。

● 対象基板サイズ		250W × 330Lmm以下 高さ 保持面上下共15mm以下
● 実装部品高さ制限	キャリアバー 下限設定時	基板下 : 5mm / 基板上 28mm
	キャリアバー 上限設定時	基板下 : 31mm / 基板上 2mm
● 装置寸法		(W)778W × (D)860.5 × (H)1,417mm (シグナルタワー含まず)
● 加熱方式		上面 : 熱風・遠赤外線輻射併用 下面 : 遠赤外線輻射
● 冷却方式		外部ガス (窒素または空気) 導入によるオートクーリング
● 電源		3相 200V 50/60Hz 10.4kVA
● 外部ガス		0.3 ~ 0.5MPa 100ℓ / min (MAX)
● 炉内酸素濃度 (窒素使用時)		最低100ppm
● 基板トレイ		ネット式またはキャリア式 (いずれか選択)
● 加熱ヒーター	上面加熱	熱風・遠赤外線ヒータ : 7.2kW (約240W × 30ブロック)
	下面加熱	遠赤外線ヒータ : 約2.4kW (400W × 6)
● 温度精度		常温 ~ 80 : ±3 / 80 ~ 330 : ±2 / 300 ~ 400 : ±3
● 測定温度		常温 ~ 400
● 測定点数		6ポイント (自動モード : 7ポイント)
● 窒素供給機能		流量調整弁 : 100ℓ / min
● 制御		内蔵PC (専用ソフト含む)
● プロファイル作成・データ解析		RDT-250RCS (対応OS : Windows10、別途外部にPCが必要)
● 装置重量		約210kg



上 : 測定プログラム設定画面 / 下 : 測定結果表示



↓ 溶融状態 (カメラ観察システムVDM-3による観察画像)

